

04;10  
©1993

# ИЗОБАРИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИСТОЧНИКА НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

*Н.В.Гаврилов, М.А.Завьялов, С.П.Никулин, А.В.Пономарев*

Основная проблема, возникающая при разработке сильноточных электронных источников с газоразрядным плазменным катодом (ЭИГПК), заключается в создании таких газовых условий, при которых обеспечивается устойчивое зажигание разряда и эффективная генерация эмитирующей плазмы и исключается возникновение газового пробоя в ускоряющем промежутке. В большинстве ЭИГПК эта проблема решается за счет прокачки газа, посредством которой создается перепад давлений между областями генерации и ускорения заряженных частиц [1]. Очевидно, что такие системы не могут быть использованы в отпаянных электронных приборах, в частности, при разработке перспективных моделей широкополосных пучково-плазменных усилителей СВЧ колебаний, обладающих совокупностью параметров, не имеющей аналогов в традиционной вакуумной электронике СВЧ [2]. Надежность таких пучково-плазменных приборов (ППП) может быть существенно повышенена при замене мощной вакуумной термокатодной пушки на ЭИГПК, работающей в изобарическом газовом режиме при том же давлении  $p$ , что и в области пучково-плазменного взаимодействия (0.09–0.13 Па), и обеспечивающей получение электронного пучка миллисекундной длительности диаметром 1 см с током до 3 А и энергией частиц до 20 КэВ.

Устойчивое горение разряда при низких давлениях достигается при использовании газоразрядных систем с осцилляцией электронов в катодной полости или в магнитном поле [3]. Существенным недостатком разряда с полым катодом является то, что для его зажигания при низких давлениях требуется применение систем инициирования, снижающих надежность устройства. В случае же разряда в магнитном поле напряжение зажигания незначительно превышает напряжение горения  $U$ .

Исходя из этих соображений, а также учитывая, что ППП находится в магнитном поле, в качестве объекта исследований была выбрана система типа "обращенный магнетрон", схематично представленная на рис. 1. Магнетрон-

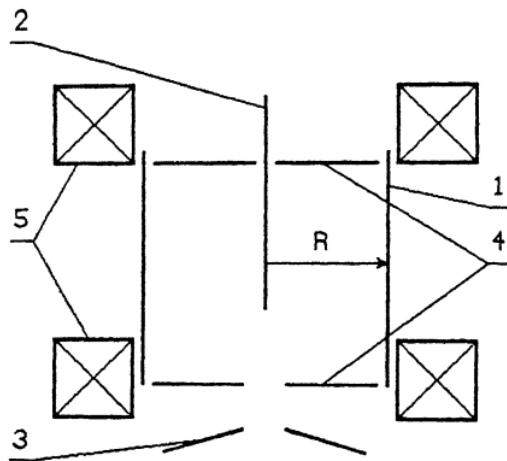


Рис. 1. Электродная система.

ная ячейка образуется цилиндрическим катодом 1 из нержавеющей стали и стержневым анодом 2, размеры которых оптимизировались в ходе экспериментов. Электроны из плазмы разряда извлекались полем ускоряющего электрода 3 или плоского коллектора, размещавшегося в осевом эмиссионном отверстии диаметром 12 мм в одном из торцевых электродов 4, имевших катодный потенциал. Магнитное поле создавалось катушками Гельмгольца 5.

Такая разрядная система, в которой уход быстрых электронов из разряда затруднен как вследствие малости отношения площадей анода и эмиссионного отверстия к площади катода  $S$ , так и вследствие влияния магнитного поля, сочетает достоинства обоих вышеуказанных типов разряда. Благодаря этому устойчивое зажигание сильноточного (ток разряда  $I_d = 1-10$  А) тлеющего разряда в аргоне наблюдалось до давления  $p_1 = 0.04$  Па. Верхняя граница рабочего диапазона источника  $p_2 = 0.18$  Па определялась возникновением пробоев в ускоряющем промежутке. Отметим, что стабильное горение разряда при низких  $p$  и  $U \lesssim 600$  В оказалось возможным лишь в довольно узком диапазоне значений магнитной индукции  $B$ . Качественный анализ показал, что при  $D \lesssim (mU/e)^{1/2}/R$ , где  $e$  и  $m$  — заряд и масса электрона, горение разряда затрудняется вследствие возрастания потерь быстрых частиц, а при  $B \gtrsim (\nu/R)^{1/2}(mMkT)^{1/4}/e$ , где  $\nu$  — эффективная частота упругих столкновений,  $k$  — постоянная Больцмана,  $T$  — температура электронов,  $M$  — масса иона, механизм классической диффузии недостаточен для транспортировки медленных максвеллизированных электронов к аноду, что приводит к резкому увеличению уровня шумов разрядного напряжения и токов на анод  $I_a$  и коллектор  $I_c$ . Оценки по приведенным выражениям при

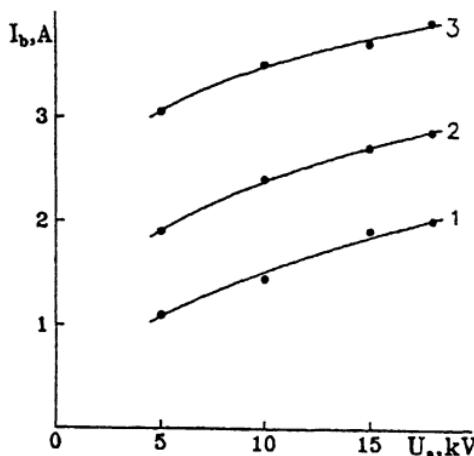


Рис. 2. Вольт-амперные характеристики источника, аргон,  $p = 0.13$  Па,  $I_d(A)$ : 1 — 4; 2 — 6; 3 — 10.

$R \sim 3$  см и  $p \sim 0.1$  Па дают величину  $B$  порядка нескольких миллитесла, что согласуется с результатами экспериментов.

Отношение плотности электронного тока насыщения на коллектор к средней плотности ионного тока на катоде было в несколько раз меньше величины  $(M/m)^{1/2}$ , что подтверждает использовавшееся при оценках допущение о наличии значительного радиального градиента концентрации плазмы  $n$ . Поскольку  $n$  на оси системы мало, то большое внимание в ходе экспериментов было уделено проблеме повышения эффективности извлечения электронов из плазмы. Было установлено, что увеличению  $I_c$  способствуют уменьшение  $B$  и  $S$ , создание неоднородного магнитного поля с повышенной напряженностью в области эмиссионного отверстия, а также выбор оптимальной длины анода  $L$ , поскольку зависимость  $I_c(L)$  оказалась немонотонной. Эта немонотонность может быть объяснена тем, что при больших  $L$  коллектор частично экранируется анодом, а при малых  $L$  уменьшение  $I_c$  происходит вследствие того, что разряд становится неоднородным в продольном направлении и преимущественно горит в области расположения анода. Как и в [4], при подаче на коллектор положительного потенциала относительно катода ток в катодной цепи возрастал на величину  $I_c$ , а значение  $I_a$  практически не менялось.

ВАХ источника, снятые в импульсно-периодическом режиме при частоте следования 5 Гц и длительности импульса 2 мс для нескольких значений  $I_d$ , приведены на рис. 2. С увеличением  $I_d$  ток пучка  $I_b$  возрастает, что связано с действием двух факторов: увеличением  $n$  и уменьшением протяженности прикатодного ионного слоя. Длина слоя умень-

шается, поскольку с повышением  $I_d$  растет плотность ионного тока на катоде, а падение потенциала на слое, которое практически равно  $U$ , изменяется незначительно, так как ВАХ разряда близка к горизонтальной в широком диапазоне  $I_d$ . Эффективность извлечения  $\alpha = I_b/I_d$  растет с увеличением ускоряющего напряжения  $U_a$ , причем скорость роста и максимальная величина  $\alpha$  выше для малых  $I_d$ . Это объясняется увеличением кривизны и площади плазменного мениска при уменьшении  $n$ , что подтверждено результатами компьютерного моделирования динамики электронов в системе формирования пучка.

Полученные в настоящей работе результаты показали возможность создания квазистационарных источников нерелятивистских электронных пучков с плазменным эмиттером, устойчиво работающих в изобарическом газовом режиме при низких давлениях и обеспечивающих плотность эмиссионного тока на уровне эффективных термокатодов, что существенно расширяет область возможных применений ЭИГПК. Рабочий диапазон давлений разработанного ЭИГПК перекрывает интервал, в котором наиболее эффективно работают пучково-плазменные усилители СВЧ, а достигнутые параметры пучка являются достаточными для обеспечения импульсно-периодического режима работы ППП в миллисекундном диапазоне длительности импульса.

### Список литературы

- [1] Бугаев С.П., Крейндель Ю.Е., Щанин П.М. Электронные пучки большого сечения. М.: Энергоатомиздат, 1984. 112 с.
- [2] Perevodchikov V.I., Zavjalov M.A., Martynov V.F. et al. Proc. IX Int. Conf. on High-Power Particle BEAMS. USA. 1992. P. 183.
- [3] Метель А.С. // ЖТФ. 1985. Т. 58. В. 10. С. 1928–1934.
- [4] Окс Е.М., Чагин А.А., Щанин П.М. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 10. С. 188–190.

Поступило в Редакцию  
30 марта 1993 г.

---